

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 8 月 12 日 (12.08.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/068627 A1

- (51) 国際特許分類: H01M 14/00, H01L 31/04
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/016938
(22) 国際出願日: 2003 年 12 月 26 日 (26.12.2003)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2003-21410 2003 年 1 月 30 日 (30.01.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 Tokyo (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石橋 賢一 (ISHIBASHI, Kenichi) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川

区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 戸木田 裕一 (TOKITA, Yuichi) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 諸岡 正浩 (MOROOKA, Masahiro) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 鈴木 祐輔 (SUZUKI, Yusuke) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 野田 和宏 (NODA, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).

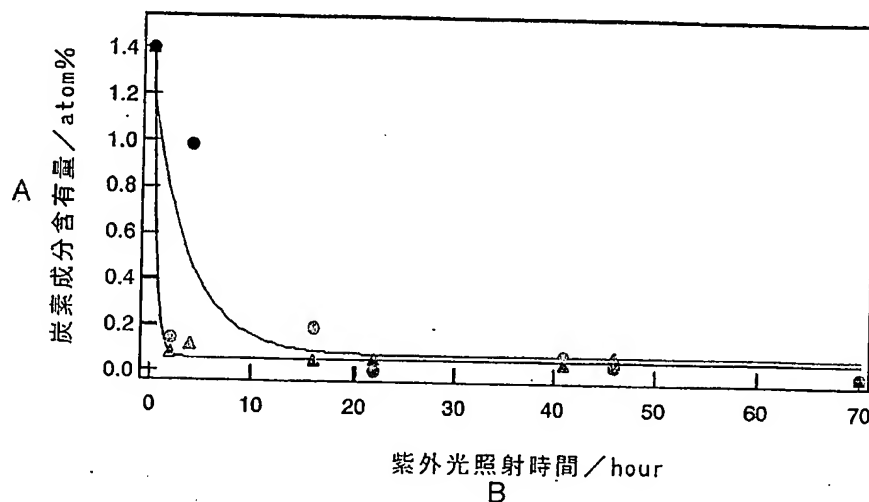
(74) 代理人: 森 幸一, 外 (MORI, Koh-ichi et al.); 〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2 丁目 49 番 7 号 池袋パークビル 7 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,

/ 続葉有 /

(54) Title: PHOTOELECTRIC CONVERSION ELEMENT AND PROCESS FOR FABRICATING THE SAME, ELECTRONIC APPARATUS AND PROCESS FOR FABRICATING THE SAME, AND SEMICONDUCTOR LAYER AND PROCESS FOR FORMING THE SAME

(54) 発明の名称: 光電変換素子およびその製造方法ならびに電子装置およびその製造方法ならびに半導体層およびその製造方法



A...CONTENT OF CARBON COMPONENT/ atom %
B...UV-RAY IRRADIATION TIME/ hour

(57) Abstract: Paste produced by mixing fine particles of a semiconductor, e.g. fine particles of titanium oxide, and a binder consisting of a polymer compound is applied onto a transparent conductive substrate and fired to form a semiconductor layer of fine particles of the semiconductor. It is then irradiated with UV-rays in order to remove organic matters remaining in the semiconductor layer through photocatalytic action of fine particles of the semiconductor.

WO 2004/068627 A1



DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。